PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-001705

(43)Date of publication of application: 06.01.1989

(51)Int.CI.

CO8F 8/04

G02B 1/04

(21)Application number: 62-155567

(71)Applicant : NIPPON ZEON CO LTD

(22)Date of filing:

(72)Invente

(72)Inventor: OSHIMA MASAYOSHI

NATSUUME YOSHIO

(54) NOVEL OPTICAL MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical material useful for optical fibers and and lenses, having excellent light transmission, heat resistance and water—vapor resistance, comprising a cyclized conjugated diene polymer or a hydrogenated substance thereof as a constituent component. CONSTITUTION: An optical material comprising a cyclized conjugated diene polymer having ≥80% ring formation ratio or a hydrogenated substance thereof as a constituent substance. A conjugated diene (co)—polymer containing a unit shown by formula I or II (R1WR6 are H, alkyl or aryl) in the polymer chain is preferable as the conjugated diene polymer, the cyclized conjugated diene polymer is obtained by dissolving the polymer in an inert solvent and bringing the solution into contact with a catalyst for ring formation such as p− toluenesulfonic acid and the hydrogenated substance thereof is prepared by hydrogenating the cyclized conjugated diene polymer in the presence of a hydrogenating catalyst usually under 1W150 atmospheric pressure at 20W150° C.

24.06.1987

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

® 公開特許公報(A)

昭64 - 1705

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和64年(1989)1月6日

C 08 F 8/04 G 02 B 1/04

MGB

7167-4 J 7915-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

夕発明の名称

新規な光学材料

②特 頤 昭62-155567

発

20出 願昭62(1987)6月24日

⑩発 明 者 大 島 正

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目2番1号 日本ゼオン株

式会社技術開発センター内

砂発明者 夏梅 伊男

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目2番1号 日本ゼオン株

式会社技術開発センター内

⑪出 願 人 日本ゼオン株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

砂代 理 人 弁理士 滝野 秀雄 外1名

明 細 :

1. 発明の名称

新規な光学材料

2.特許請求の範囲

8 0 %以上の現化率を有する共役ジェン系重合体限化物またはその水素添加物を構成成分とする 光学材料。

3.発明の詳細な説明

(産衆上の利用分野)

本発明は光学材料に関し、更に詳しくは光透過 率、耐熱性および耐湿性に優れた光学材料に関す る。

(従来の技術)

コンパクトディスク、ビデオディスク、コンピューターディスク等に用いられる光学記録媒体用の材料としては、一般にガラスあるいは高分子物質が用いられているが、大量生産する場合には成形加工の容易さからプラスチック性の材料が望ましい。この場合、プラスチック材料に要求される特性として、(1)透明で高い光線透過率を有し、ま

た屈折率が安定しており復屈折率が小さい等の光学的特性が良好なこと、②アルミニウム、銀等の光反射層との密着性がよくかつ腐蝕に対する保護力が大きい等の化学的特性があること、⑤ 恐板として必要な強度を有し、また充分な耐熱変形性などの物理的特性を有すること、④ 成形加工性の良好なこと、等が挙げられる。

現在、このような要求を比較的に満たしうるプラスチック材料としてポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート等が用いるれて g) が高く、ではからないであるが、吸湿性がや高く、ないが変になって、ないメチルメタクリレートは透明を起こしやすく、かつ分子構造上加水分解性を有する。一方、ポリメチルメタクリレートは透明で洗りが上げているが、吸湿性が高いので光反射層が腐蝕したり、対法形状の変化に伴ってディスク面にそりが生じたりする。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明者らは前記欠点を解決すべく観意研究の

結果、80%以上の歴化率を有する共役ジェン系 重合体理化物またはその水素添加物が、光透過率、 概械的強度、耐熱性および耐湿性などの光学材料 に適した特性を有することを見出し、この知見に、 基づいて本発明を完成するに至った。

(問題点を解決するための手段)

かくして本発明によれば、80%以上の環化率 を有する共役ジェン系重合体限化物またはその水 電派加物を構成成分とする光学材料が提供される。

本発明の光学材料として用いられる共役ジェン 系重合体環化物は、共役ジェン系重合体を原料と して従来公知の方法により環化することによって 得ることができる。

上記の原料として用いられる共役ジェン系取合体は、重合体質中に下式で示される単位を有する 共役ジェンの重合体または共重合体である。

ある。分子量が小さいときは、これから得られる 環化物の物性が劣り、大きすぎるときは、溶媒に 溶解したときの粘度が高く、環化反応が困難になったり経済的でない等の問題がある。ここで分子 量は、ポリスチレンを基準としてテトラヒドロフ ランをキャリアーとする高速液体クロマトグラフィーで測定したもの(Mw)である。

本発明における共役ジェン系重合体の原化物は、 従来公知の方法に従い、共役ジェン系監合体を不 活性溶媒に溶解し、次いで頭化触媒と接触させる ことにより得ることができる。

理化触媒は、特に限定されるものではなく、例えばpートルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸等のスルホン酸類、例えば四塩化スズ、塩化第二鉄、三乳化ホウ素エーテル錯体等のフリーデルクラフツ触媒等を挙げることができる。理化触媒の使用量は、通常、共役ジエン系重合体100部当り0.1~15部である。

不活性溶媒は、環化触媒及び環化反応中に生成

式中、R,~R。は水α原子、アルキル基またはアリール誌である。

上記単位の具体例としては、1.4-ポリプタジエン単位、1.4-ポリイソプレン単位、1.4-ポリベンタジエン単位、1.2-ポリプタジエン単位、1.2-ポリイソプレン単位、1.4-ポリイソプレン単位、1.4-ポリ (2-フェニルブタジエン) 単位、1.2-ポリベンタジエン単位等を挙げることができる。

また、これらの共役ジェン単位と共重合できる不飽和単量体としては、例えばスチレン、例えばアクリロニトリル、メタクリロニトリル等のロニーリル等のリーン性不飽和ニトリル化合物、例えばメタクリルではメチル、アクリル酸エチル等の不飽和カルボンとエステル等を挙げることができる。共役ジェン組位と上記の不飽和単量体単位の割合は、100/0~10/60である。好ましくは100/0~40/60である。

これらの共役ジェン系重合体の分子量は、通常、 5万~200万、好ましくは10万~100万で

するカチオンと反応しないものであればよく、その例としては、例えばベンゼン。トルエン。キシレン。ヘキサン。ヘブタン等の炭化水素、例えば 塩化メチレン。クロルベンゼン等のハロゲン化炭 化水素を挙げることができる。

環化反応溶液中の共役ジェン系重合体の温度は、 使用する共役ジェン系重合体の種類や環化の条件 により異なるが、通常、0.5~20%程度である。

環化反応の圧力、温度は、特に限定されないが、 通常、常圧下、0~120年の温度で行なう。

環化反応において所定の環化率に到達したのち、水または塩酸や硫酸等の酸水溶液、炭酸ナトリウムや水酸化ナトリウム等のアルカリ性水溶液等で反応を停止するとともに反応系を洗浄し、頃化触媒残渣を除去することにより、環化物の溶液が得られる。更に、この溶液を遠心分離することにより、溶液中に微量含まれる水分等を除去してもよい。

次に、この溶液を共役ジェン系重合体限化物の 非溶媒中に投入する等の公知の方法により、環化 物を固体として回収する。

なお、本発明の共役ジェン系共重合体 原化物には、ゲル化を防止するため、フェノール系、スルフィド系、ホスファイト系、アミン系等の、通常の老化防止剤を添加することができる。

本発明においては、共役ジェン系共重合体環化物の環化率は、80%以上とすることが必要である。 環化率が80%未満の場合には、得られる環化物の耐熱性が低く、実用に供することができない。

ここで現化率は、ポリイソプレン系重合体の場合には、フォトグラフィック サイエンス アンド エンジニアリング 16巻6号、p443~448に記載されたアール・ケイ・アグニホトリらの方法により、また、ポリブクジエン系重合体の場合には、ジャーナル オブ ポリマー サイエンス、ポリマー ケミストリー エディション 17巻、p3027に記載された田中らの方法により、プロトンNMRスペクトルにより測定される。

水素添加反応は、触媒の種類により均一系または不均一系で、1~150気圧の水素圧下、0~200℃、好ましくは20~150℃で行われる。こうして得られた水素添加物に、さらに耐酸化 労化性を良好なものとするために紫外線吸収剂等 また、共役ジェン系共宜合体環化物の分子量は、 前記の分子量額定法によって得た値(Mw)で1 万~100万であるのがよく、好ましくは5万~ 80万である。

次に本発明における光学材料として用いられる 共役ジェン系重合体限化物の水素添加物は、前述 のようにして得た共役ジェン系重合体の現化物を 水素添加することによって得ることができる。水 素添加率は、共役ジェン系重合体であのすべて の二重結合が水素添加により飽和された場合を1 00%とすると、理論的には0~100%の範囲で 水素圧 との近にない があり、実際にも、その範囲で水素圧、反応 反応時間、触媒爆度などを変えることにより任意 に選択できるが、耐熱性や耐光性を向上させるため めには、高い方が好ましい。

この共役ジェン系重合体現化物の水素添加反応 は通常公知の方法により行われる。水素化触媒と しては、オレフィン化合物の水素化に際して一般 に使用されているものであれば使用可能であり、 特に制限されないが、たとえば次のようなものが

の安定剤を透明性の低下しない範囲において添加 することができる。また、これと相違する他の重 合体を混合して使用することも可能である。

本発明の共役ジェン系重合体環化物またはその 水素添加物を光学材料として成形する方法として は、キャスティング法、圧縮成形法、射出成形法、 スピンコート法等の通常の成形方法が挙げられる。

得られた成形品はコンパクトディスク、ビデオディスク、コンピュータディスク等の光学式記録材料の他に適明性、耐器性、耐熱性等の特性を生かして光ファイバー。光ファイバーコネクター、ブリズム、プラスチックレンズ等の光通信、レンズ、またはフォトレジストの保護膜、キャリアフィルム等の分野にも用いることができる。

以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に 説明する。なお、実施例、比較例及び参考例中の 部及び%はとくに断りのないかぎり重量基準であ a

参考例1

内容積 2 & のセパラブルフラスコに、イソブレ

ン競合体(シス-1.4- 掃造単位 4 4.8 %. トランス-1.4- 構造単位 1 9.6 %. 3.4 構造単位 3 5.6 %. Mw=2 3.5 万) 1 0 gを入れ窓素置換にた後、脱水したトルエン3 9 0 gを全窒素気流したた後、脱拌し均一な溶液とした。反応系の温度でを2 0 でに保ち、トリフロメタンスルホン酸 0.1 gを加え6 0 分間健伴した。次いで関押したが存止した。生成物のゲル化を防止するため B H T (2.6-ジー t ーブチルフェノール) 0.1 gを加えたの収し、更にメタノールで洗浄後乾燥した。回収た現にメタノールで洗浄後乾燥した。回収た現化であった。

经考例 2

参考例1で得られた重合物のシクロヘキサン5 **浴液 4 0 0 g を、1 g オートクレーブにカーボンに 5 %のパラジウムを担持させた触媒 2 g とともに仕込んだ。反応器を水器置換後攪拌しながら1 2 0 でに昇退した。反応器の温度が一定となっ

洗浄を5回線返した。これを大遇剰の1 % B H T メタノール溶液に投入してポリマーを回収し、波圧乾燥した。この環化ポリイソプレンのM w は 1 6 万、環化率は8 5 %であった。これを参考例2 の方法に従って水素添加率9 5 %のポリマーを得た。

参考例 5

イソプレン重合体の替わりにブタジェン重合体 (Mw=21万、1,2 - 構造単位 96%、トランス - 1.4 - 構造単位 4%) を用いる以外は参考例 1 と同様にして Mw=15.5万、環化率 97%、Tg98での環化物を得た。

参考例 6

反応時間を180分とする他は参考例4と同様にしてMw=16.5万、環化率72%の環化ポリイソプレンを得た。

事 旃 例 1

参考例 1 ~ 6 で得られたポリマー及びポリメチルメタクリレートを 2 %トルエン溶液とし、ガラス板上にキャスト成形して厚さ 1 0 μ m の薄膜を

たところで水素圧を 7 0 気圧に昇圧した。反応により情致した水素を補充しながら 8 時間反応させた後、反応物中の触媒を濾過し、多量のアセトンーイソプロピルアルコール(1 / 1)混合溶媒中に沈殴させ濾過乾燥した。得られた水素添加物の水素添加率は 9 5 % であった。

参考例3

ポリイソプレン (シス-1,4-構造単位 9 8 %. トランス-1,4-構造単位 2 %, M w = 7 0 万) を 用いる値は、参考例 1 と同様にして環化率 9 5 %, M w = 2 5 万の環化ポリイソプレンを得た。

参考例 4

ポリイソプレン (シスー1,4-構造単位 8 6 %. トランスー1.4-構造単位 1 2 %. 3.4-構造単位 2 %. Mw=20万) の6 %トルエン熔板 1 0 0 0 gを2 gのガラス製セパラブルフラスコに入れ、系を窒素置換したのち、攪拌下に85 ででpートルエンスルホン酸2.5 gを投入した。攪拌を5時間続けたのち、250 gの水を投入して反応を停止した。静置後、油層を分離し、250 gの水で

掛た。

また、参考例2で得られた現化ポリイソプレンを金型内で200℃、100kg/calで加圧成形し、厚さ1 == の成形物を得た。

これらの薄膜及び成形物の特性を表1に示す。

特開昭64-1705(5)

(発	叨	Ø	2ከ	171.	•
٠,	æ	71	w	~//	~	4

以上 及明したように、本発明に従って80%以上の環化率を有する共役ジェン系 其合体環化物またはその水素添加物を構成材料とすることにより従来技術に比較して光透過性、耐熱性、耐湿性にすぐれた光学材料を得ることができる。

特許出願人	日本ゼオン	/株式会社
代 理 人	微野	75 M
同	推 尾	10 E

契條時	1	2	3	1	S	9	٦.	.8	追引
JP11 -0 - 1200	1 4	\$ 2 \$	\$ 3 8	1 3	\$ \$	2 4	9 \$3	1	
	界がシ	1	t	1	野洲	學學	t	PMMA	
978 CD	18.0	18.0	25.0	16.0	15.5	18.0	16.5	ı	药物207
部四	96	96	\$6	8.5	. 16	96	7.2	-	NMR
水浴 000	0	9.5	0	9.5	0	9.5	0	1	NMR
Te (T)	100	102	86	7.0	8 6	102	5.2	9.8	DSC
KO. C. ST.	06	95	9.6	9.5	9.1	9.5	88	9.3	7178 SIL
(Boyota	0.02	0.01	0.0	a.01	0.02	0.01	0.01	0.4	11690 SIF
部標	444	1	t	1	1	77.	#+2.t	*+3}	
•	H 68								

■: ポリメチルメタクリレート C重レーコン社製 フクリライト)